（プロセスエンジニアのサンプル）

職 務 経 歴 書

20xx年xx月xx日現在

氏名　○○ ○○

■職務要約

株式会社○○○○○に入社後、約x年間、要素エンジニアとしてDRAM、NAND、ロジックなどの半導体のフォトリソグラフィ工程で、プロセス開発や量産移管などに携わってきました。最初のx年間は不具合改善と量産移管を担当し、分析調査と改善プロセスの基本的な業務を把握しています。x年からは約xx名のチームのサブリーダーとして、新規プロセスフローの開発に従事。フロー立案から材料選定、クライアントとの折衝など幅広い業務を行っています。

■職務経歴

|  |
| --- |
| 20xx年xx月～現在　　株式会社○○○○○ |
| 事業内容：各種機器に搭載する半導体製品の開発、製造資本金：x千万円（20xx年xx月）　売上高：x億x千万円（20xx年xx月）従業員数：xxx人　上場：未上場 | 正社員として勤務 |
| 20xx年xx月～現在　【担当製品】〇〇〇社　ロジックデバイス | 環境／ツール | 規模／役割 |
| 【業務内容】・フォトリソグラフィ工程での新規プロセスフローの共同開発・新規芯材・ダブルパターニング技術を用いた工程確立・新規芯材の選定、検討（レジストメーカーとの開発）・プロジェクトの進捗・品質管理・共同開発会社、クライアントとの折衝【実績・取り組み】・プロセスのコスト低減、歩留まり改善を目的としたプロジェクトに参加しました。従来のダブルパターニング技術での工程を分析し、長時間かつ複雑なプロセスが大きくコスト増加に影響していると判断。芯材と導入技術の一部を変更することで、歩留まり約xx％改善、生産コストxx％削減に貢献しました。 | SEMレジストコータ膜厚計ArF露光装置現像装置 | 全xx名サブリーダー |
| 20xx年xx月～20xx年xx月　【担当製品】〇〇〇社　MEMSデバイス | 環境／ツール | 規模／役割 |
| 【業務内容】・フォトリソグラフィ工程のプロセス開発・微細配線の膜厚均一性の改善・ディフェクトコントロール・量産移管【実績・取り組み】・フォトレジストの塗布工程では、海外の成膜装置導入に伴い、膜厚の安定化を目的にメーカーと共同で開発。実験検証を重ねて、今までの量産工程に大きな影響を与えない移管方法を組み立てることができました。 | スプレーコーターSEM膜厚計アライナー現像装置 | 全xx名メンバー |
| 20xx年xx月～20xx年xx月　 | 環境／ツール | 規模／役割 |
| 新人研修／工場実習 |  |  |

■活かせる経験・知識・技術

・半導体製品でのフォトリソグラフィ工程の知識

・フォトリソグラフィ工程のプロセス開発、フロー改善

・フォトリソグラフィの解析手法に関する基礎知識

・協力会社との英語での共同開発経験

・約xx名のチームのサブリーダー経験

■資格

|  |  |
| --- | --- |
| 普通自動車第一種運転免許 | 20xx年xx月取得 |
| TOEIC Listening & Reading Test xxx点  | 20xx年xx月取得 |

■自己PR

＜プロセスフロー構築の豊富な経験＞

欠陥品の制御や量産移管を経験してきたことで、半導体のフォトレジスト工程フローの問題発生箇所を熟知しており、適切に問題を切り分けられます。新しい技術を量産製造できるレベルにまで引き上げるため、目標歩留まり、納期、規模などを勘案して、フロー立案から課題を洗い出し、改善するといった一連の業務を実行、指示してきました。特にDRAM半導体に関するプロセス知識の収集、開発技術の研鑽には意欲を持って取り組んでいます。

＜プロジェクトを推進する説明力＞

サブリーダーとして共同開発する会社や顧客との折衝を担当。新規プロセスフローの開発という、関係各所との円滑なコミュニケーションなしには成り立たない業務に携わることで、相手の立場に立って、ロジカルに分かりやすく物事を説明する能力を培うことができました。問題事項は事前にフロー図や資料を作成し、3社間で共有して課題を明確にしてから打ち合わせるなど、スピーディーにプロジェクトを推進するための根回しも得意としています。

以上